

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 5 月 6 日 (06.05.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/040931 A1

(51) 国際特許分類: G03F 7/42, H01L 21/027, 21/304

6794124 兵庫県龍野市龍野町中井 2 3 6 ナガセケム
テックス株式会社内 Hyogo (JP).

(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/016012

(74) 代理人: 古谷 信也 (FURUTANI, Shinya); 〒5300003
大阪府大阪市北区堂島二丁目 1 番 2 7 号古谷内外特
許事務所 Osaka (JP).

(22) 国際出願日: 2004 年 10 月 28 日 (28.10.2004)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が
可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,
BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,
ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS,
LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA,
NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE,
SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US,
UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2003-369349
2003 年 10 月 29 日 (29.10.2003) JP

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可
能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD,
SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY,
KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG,
CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE,
IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF,
BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN,
TD, TG).

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): ナガセ
ケムテックス株式会社 (NAGASE CHEMTEX COR-
PORATION) [JP/JP]; 〒5508668 大阪府大阪市西区新
町 1 丁目 1 番 1 7 号 Osaka (JP).

(72) 発明者: および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 西嶋 佳孝 (NISHI-
JIMA, Yoshitaka) [JP/JP]; 〒6794124 兵庫県龍野市
龍野町中井 2 3 6 ナガセケムテックス株式会
社内 Hyogo (JP). 松本 昌岳 (MATSUMOTO, Masatake)
[JP/JP]; 〒6794124 兵庫県龍野市龍野町中井 2 3 6 ナ
ガセケムテックス株式会社内 Hyogo (JP). 安江 秀
国 (YASUE, Hidekuni) [JP/JP]; 〒6794124 兵庫県龍野
市龍野町中井 2 3 6 ナガセケムテックス株式会
社内 Hyogo (JP). 武井 瑞樹 (TAKEL, Mizuki) [JP/JP]; 〒

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される
各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語
のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: COMPOSITION FOR SEPARATING PHOTORESIST AND SEPARATING METHOD

(54) 発明の名称: フォトレジスト剥離用組成物及び剥離方法

(57) Abstract: Disclosed is a composition for separating a photoresist which contains a reaction product of a primary or secondary organic amine having a hydroxyl group with an ethylene carbonate, propylene carbonate, γ -butyrolactone, 1,3-dihydroxy-2-propanone, or a monovalent or divalent carboxylic acid, if necessary an organic amine, and a water-soluble organic solvent and/or water. This composition is capable of removing a photoresist with high performance and preventing corrosion of a metal wiring material. By using such a composition, there occurs no problem such that impurities precipitate and adhere to the substrate or the like during water rinsing after separation.

(57) 要約: エチレンカーボネート、プロピレンカーボネート、 γ -ブチロラクトン、1, 3-ジヒドロキシ-2-プロパノン又は 1 価若しくは 2 価のカルボン酸と水酸基を有する 1 級又は 2 級の有機アミンとの反応物、必要により有機アミン、並びに、水溶性有機溶剤及び/又は水、を含有するフォトレジスト剥離用組成物であって、フォトレジストを高性能で除去でき、しかも金属配線材料の腐食を防止でき、なおかつ、剥離後の水リンス時に不純物が析出して基板などに再付着することがないフォトレジスト剥離用組成物を提供する。

WO 2005/040931 A1